

第 22 回 Cat-CVD 研究会 講演プログラム

2025 年 6 月 20 日 (金)

9:00～10:00 研究会 受付

10:00～10:05 開会挨拶

(実行委員長：岐阜大学 伊藤 貴司)

01 : 10:05～10:35

ダイヤモンド電子舌センサ

大曲 新矢

産総研 九州センター

02 : 10:35～11:05

低温プロセスにおけるラジカルの効果

武山 眞弓

北見工業大学

03 : 11:05～11:35

5－10 ミクロン/分 を超える高速製膜 Cat-CVD 法

松村 英樹

北陸先端科学技術大学院大学

11:35～13:00 休憩

04 : 13:00～13:30

(仮)Cat-CVD の化合物半導体デバイスへの応用

奥 友希

三菱電機株式会社

05 : 13:30～14:00

(仮)加熱触媒により生成したラジカルを用いた表面改質

和泉 亮

九州工業大学

06 : 14:00～14:30

ホットワイヤ酸素化、水素化によるデバイス性能の向上について

清水 耕作

日本大学

14:30～14:45 休憩

07 : 14:45～15:15

原子状水素アニールによる表面改質

部家 彰

兵庫県立大学

08 : 15:15～15:45

Cat-CVD によるペロブスカイト太陽電池への窒化 Si 膜堆積

太平 圭介

北陸先端科学技術大学院大学

09 : 15:45～16:15

(仮)電気二重層キャパシタ用カーボンナノウォール電極の開発

伊藤 貴司

岐阜大学

16:15～16:30 休憩

16:30～ 一般講演・ポスター発表

閉会挨拶

(実行委員長：岐阜大学 伊藤 貴司)

次回開催のご案内